

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 21 年 5 月 7 日 (2009.5.7)

【公表番号】特表 2008-541430 (P2008-541430A)

【公表日】平成 20 年 11 月 20 日 (2008.11.20)

【年通号数】公開・登録公報 2008-046

【出願番号】特願 2008-510064 (P2008-510064)

【国際特許分類】

H 0 5 K 3/46 (2006.01)

H 0 1 L 21/3205 (2006.01)

H 0 1 L 23/52 (2006.01)

H 0 1 B 13/00 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K 3/46 G

H 0 1 L 21/88 Z

H 0 1 B 13/00 5 0 3 D

【手続補正書】

【提出日】平成 21 年 3 月 16 日 (2009.3.16)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

反復導電パターンを備えている多層製品を作製する方法であって、
能動素子構成の領域で用いる反復パターン構成を決定することと、
パターン付き導電材の少なくとも一つの層を有し、該層が組み立てた時に連続ウェブからさまざまな前記能動素子構成の領域が形成されるように、前記反復導電パターンを形成するために構成されている多層製品の連続ウェブを形成すること、
とを含む方法。

【請求項 2】

カスタマイズされた能動素子を形成するために、前記連続ウェブを変更することを含み、
前記連続ウェブを形成することは、前記連続ウェブ上にラミネート層を形成することを含み、
前記連続ウェブを変更することは、前記導電材の一部を露出させるために、ラミネート層を介して少なくとも一つの貫通孔を切断することを含み、さらに、前記反復導電パターン上の所定の場所に位置合わせするために、前記ウェブの前記少なくとも一つの層の前記貫通孔と前記ラミネート層を整列させることを含み、
前記反復導電パターンの部分が、連続ウェビングの前記第 1 及び第 2 の層の間に封入され、連続ウェビングの前記第 1 及び第 2 の層の少なくとも一つがその中に形成されている貫通孔を有し、
前記最終製品が接触デバイスである、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

前記連続ウェブを形成することは、
連続ウェビングストックの第 1 のロールであって、その上に前記反復導電パターンの第 1 の部分が形成される該第 1 のロールを提供すること、
連続ウェビングストックの第 2 のロールであって、その上に前記反復導電パターンの第 2 の部分が形成される該第 2 のロールを提供すること、
連続ウェビングストックの前記第 1 及び第 2 のロールを合わせてラミネートすること、

を含み、

前記反復導電パターンの前記第 1 及び第 2 の部分が、前記連続ウェブを形成する工程中に、互いに対して位置合わせされている、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】

第 1 のロールの反復パターンの部分が、ウェビングストックの前記第 1 のロールの長さに沿って延びている複数の平行導電トレースを含み、前記第 2 のロールの反復パターンの部分が、ウェビングストックの前記第 2 のロールの幅を横切って横方向に延びている複数の平行導電トレースを含む、請求項 3 に記載の方法。

【請求項 5】

少なくとも一つの接触デバイスを含む異なる構成である複数の電子素子を作製する方法であって、

前記複数の電子素子に共通し、導電トレースのグリッドを含む反復導電パターンを定めることと、

一緒に前記反復導電パターンを構成する導電材の少なくとも 2 つの層を有する多層製品の連続ウェブを形成することであって、連続ウェブを形成することが、連続ウェビングストックの第 1 のロールであって、前記反復導電パターンの第 1 の部分がその上に形成される第 1 のロールを提供することと、連続ウェビングストックの第 2 のロールであって、前記反復導電パターンの第 2 の部分がその上に形成され第 2 のロールを提供することと、連続ウェビングストックの前記第 1 及び第 2 のロールを合わせてラミネートすることと、導電材から成る別個の層として前記グリッド部分を形成することと、を含み、

前記異なる電子素子構成用の設計パラメータを用意することと、

多層製品の前記連続ウェブを形成しながら、前記複数の電子素子の特徴を含むために、設計パラメータに従って前記多層製品を修正することと、を含む方法。